

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有權機關
國際事務局



(43) 國際公開日
2004 年 10 月 28 日 (28.10.2004)

(10) 国際公開番号
WO 2004/092315 A1

(51) 國際特許分類⁷: C11D 1/34, 1/29, 1/90, 1/92, 1/75, 9/02, 1/28, 1/72, A61K 7/50

(SUZUKI, Nobuyoshi) [JP/JP]; 〒640-8580 和歌山県 和歌山市 湊 1 3 3 4 花王株式会社研究所内 Wakayama (JP).

(21) 国际出願番号: PCT/JP2003/012941

(22) 國際出願日: 2003 年 10 月 9 日 (09.10.2003)

(74) 代理人: 古谷 聡, 外(FURUYA, Satoshi et al.); 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜町花長ビル6階 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-109000 2003年4月14日(14.04.2003) JP

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 花王株式会社(KAO CORPORATION) [JP/JP]; 〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号 Tokyo (JP).

(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

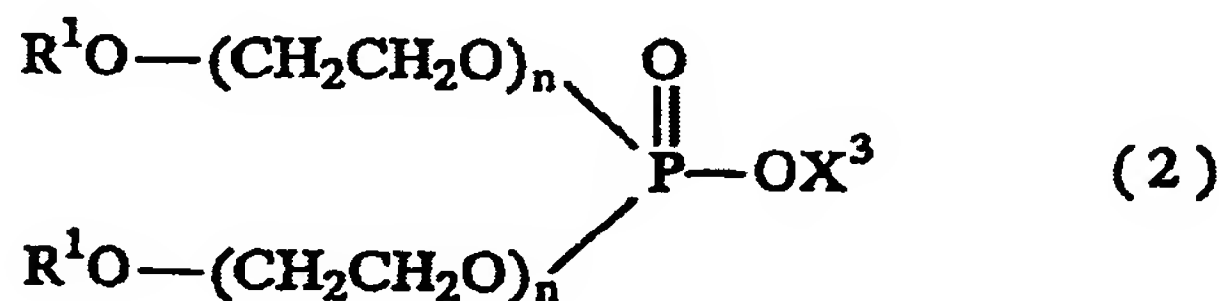
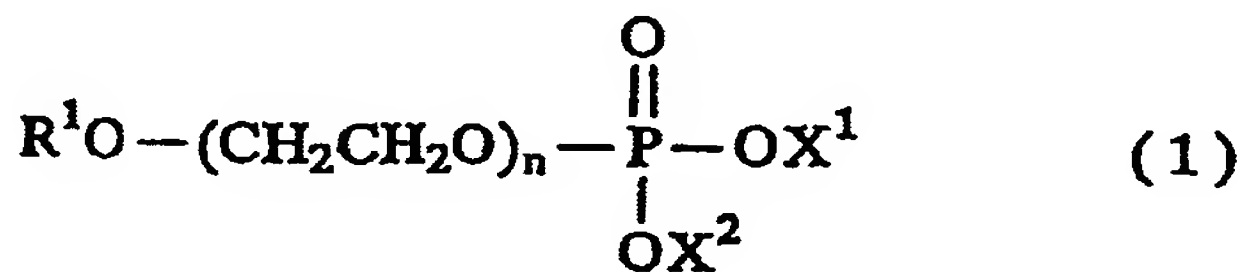
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 福田 守伸 (FUKUDA, Morinobu) [JP/JP]; 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社研究所内 Tokyo (JP). 鐵 真希男 (TETSU, Makio) [JP/JP]; 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社研究所内 Tokyo (JP). 横塚 大 (YOKOTSUKA, Dai) [JP/JP]; 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社研究所内 Tokyo (JP). 金子 洋平 (KANEKO, Yohei) [JP/JP]; 〒640-8580 和歌山県和歌山市湊1334 花王株式会社研究所内 Wakayama (JP). 鈴木 叙芳

添付公開書類：
一 國際調查報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CLEANING AGENT COMPOSITION

(54) 発明の名称: 洗浄剤組成物



(57) Abstract: A cleaning agent composition which comprises (a) a phosphomonoester represented by the general formula (1) and (b) a phosphodiester represented by the general formula (2): where R¹ represents an alkyl group or an alkenyl group having 9 to 15 carbon atoms on the average and a branching proportion of 10 % or more, X¹, X² and X³ each represent H or an alkali metal, and n is a number of 0 to 5, wherein the weight ratio of (a) component to (b) component is (a)/(b) = 65/35 to 90/10, and exhibits weak acidity. The above cleaning agent composition can exhibit satisfactory combination of low irritating property to the skin and high formability.

〔鏡葉有〕

LAST AVAILABLE COPY